PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-043482

(43) Date of publication of application: 25.02.1987

(51)Int.Cl.

C09K 3/14 B24B 37/00

(21)Application number: 60-184654

(71)Applicant : SANYO CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

21.08.1985

(72)Inventor: GENJIDA FUMIHIDE

KAWAUCHI TOMIO

(54) ABRASION WORKING FLUID

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an abrasion working fluid containing a water-soluble polymeric dispersant, a permeating surfactant, water and diamond abrasive grains, having high dispersion stability, free from the precipitation of the abrasive grain with time and effective to remarkably improve the efficiency of abrasion work.

CONSTITUTION: The objective working fluid contains (A) a water-soluble polymeric dispersant [preferably polyvinyl pyrrolidone, polyethylene glycol and/or a water-soluble polymer containing, as essential constituent component, a monoethylenic unsaturated monomer having a group selected from carboxylic acid (salt) group, amino, hydroxyl, ether group, amide group and quaternary ammonium salt group], (B) a permeating surfactant (preferably sulfosuccinic acid ester salt, alkylbenzenesulfonic acid salt, etc.), (C) water and (D) diamond abrasive grains. The content of the component A in the liquid is preferably 0.1W50(wt)% and that of the component B is preferably 0.1W20%.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Searching PAJ

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

昭62 - 43482 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)2月25日

C 09 K 3/14 24 B 37/00 X-6683-4H H-7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

研磨加工液 公発明の名称

> 昭60-184654 ②特 阻

> > 雄

昭60(1985)8月21日 顋 ❷出

文 秀 氏 田 砂発 明 者 源

京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋化成工業株式会

补内

内 明 者 Ш 冗発

京都市東山区一橋野本町11番地の1 三洋化成工業株式会

社内

三洋化成工業株式会社 们出 頣 人

京都市東山区一橋野本町11番地の1

戚

1. 発明の名称

研寧加工液

特許請求の範囲の範囲

i. 水 容 性 高 分 子 分 散 剤 (A) 、 浸 透 性 界 面 活 性 剤 (B)、 水およびダイヤモンド砥粒を含有することを特徴 とする研摩加工液。

2.(日)の含有量が加工液の重量に基いて 0.1~20% である特許請求の範囲第1項記載の加工液。

3.(B)がスルホコハク酸エステル塩、アルキルベ ンゼンスルホン酸塩、(アルキル)ナフタリンス ルホン酸塩および(アルキル)ナフタリンスルホ/ *TNDンスルホン四*変だ。ノ ン酸塩のホルマリン縮合物、アルキル硫酸エステ ル塩、脂肪酸エステル硫酸化物、ポリオキシアル キレンアルキルアリールエーテルおよびポリオキ シァルキレンアルキルエーテルからなる群より選 ばれる界面活性剤である特許請求の範囲第1項ま たは第2項記載の加工液。

4. (4) の合有量が加工液に基いて 0.1~5 0%である 特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項に 記載の加工液。

5. (A) が (1) ポリビニルピロリドン、 (2) ポリエチレ ングリコールおよび/または臼カルポン酸(塩) 盐、アミノ塩、水酸盐、エーテル基、アミド基お よび第4級アンモニウム塩基からなる群より選ば れる基を含有するモノエチレン性不飽和単低体を 必須構成成分とする水溶性重合体である特許請求 の範囲第1項~第4項のいずれか一項に記載の加 工概。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は研寧加工液に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、研摩加工液としてグリセリンのような増 粘剤を加えた水に、酸化マグネシウムなどの砥粒 を混合したものがあつた(特開昭 55-139479号公 報)。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながらてのものは、砥粒が経時的に沈降 しゃすい、研摩材料へのぬれ性および展着性が思 いという問題点を有している。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは砥粒が経時的に沈降しにくく、研摩材料へのぬれ性および展着性のよい研摩加工液を得るべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。

本発明は、水溶性高分子分散剤(以下分散剤と 略記)(M)、浸透性界面活性剤(以下浸透剤と略記) (B)、水およびダイヤモンド砥粒を含有することを 特徴とする研摩加工液である。

本発明における浸透剤(B)としては下記の浸透剤があげられる。

(1)アニオン界面活性剤

アニオン界面活性剤におよる塩としてはアルカリ金属(ナトリウム、カリウムなど)、アンモニウムおよびアミン(アルカノールアミンたとえばモノー,ジー,トリーエタノールアミンおよびプロパノールアミン)の塩があげられる。

1.スルホン酸塩

(1) スルホン酸エステル塩

ジアルキルスルホコハク酸エステル塩:アルキ

カンスルホン酸塩た.とえばラウリルスルホン酸ナ トリウム塩など。

2. 硫酸エステル塩

(1) アルキル硫酸エステル塩

炭素数が通常 6~20 の直鎖および/または分岐の飽和および/または不飽和アルコールの硫酸エステル塩:具体的な化合物としてはデシルアルコール硫酸エステルナトリウム塩、セチルアルコール硫酸エステルアンモニウム塩、オキソアルコール(C11~17、側鎖率 50%以上)硫酸エステルアンモニウム塩など。

②脂肪酸エステル硫酸化物

炭素数が通常 1~18 のアルキルアルコールと炭素数が通常 3~2 0 の不飽和脂肪酸とのエステルの硫酸化物。 たとえばオレイン酸プチル硫酸エステルナトリウム塩など。

②ノニオン界面活性剤

1. ポリオキシアルキレン系非イオン界面活性剤 (1) ポリオキシアルキレンアルキルアリールエー ル基の炭素数は通常 6~20: またアルキル基にシクロアルキル基を含む: 具体的な化合物としてはジオクチルスルホコハク酸エステルナトリウム塩およびジシクロヘキシルスルホコハク酸エステルナトリウム塩など。

(2) アルキルベンゼンスルホン酸塩

炭素数が通常 8~20 の分岐または直鎖の 1 個および/または複数個のアルキル基を有するアルキルベンゼンスルホン酸塩:具体的な化合物としてはドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩など。
(3) (アルキル)ナフタリンスルホン酸塩のホルマリン縮合物

ナフタリンスルホン酸または炭素数通常 1~18 の1個および/または複数個のアルキル基を有するナフタリンスルホン酸塩およびホルマリン縮合物:具体的な化合物としてはジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウムなど。

(4) アルカンスルホン酸塩

炭素数が通常 8~20 のアルキル塩を有するアル

テル

炭素数通常 8~1 2 のアルキル基を少なくとも 1 個有するアルキルフェノールもしくはアルキルナフトールの A O 付加物 (A O の付加モル数は通常 2~5 0 、好ましくは 7~2 0)たとえばノニルフェノールE O 00、オクチルフェノールE O (8) P O (2) など (上記および以下において A O はアルキレンオキサイド、E O はエチレンオキサイド、P O は オ ナ ナ イ ド を 示す。 また () 内はモル数を示す。 注・オクチルフェノールE O 8 モルP O 2 モルを C の順に付加したものである。)

(2) ポリオキシアルキレンアルキルエーテル

脂肪族アルコール(炭素数 6~20、好ましくは 炭素数 10~18で、直鎖、または分岐の天然また は合成アルコール)の A O 付加物。(A O の 付加 モル数は通常 2~50、好ましくは 2~20) たとえ ばオクチルアルコール E O (6)、ラウリルアルコー ル E O 00 など。

これらの浸透剤田は単独でまた二種以上の組合

せで用いられる。

これらの没透剤(B)のうちで好ましいものは、スルホコハク酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩およびポリオキシアルキレンアルキルアリールエーテルである。

本発明における分散剤Wとしては下記の分散剤があげられる。

(1) ポリピニルピロリドン

分子鼠が少なくとも 1 万、好ましくは 2 万 ~ 8 万のもので特額昭 60-22170号明細書に記載のも のが使用できる。

(2) ポリエチレングリコール

分子母が通常 1000~10 万、好ましくは 1000~2 万のもので特願昭 60-46963 号明細書に記 私のものが使用できる。

(3) カルボン酸(塩) 基、アミノ基、水酸基、エーテル基、アミド基および第 4 級アンモニウム塩 基からなる群より選ばれる基を含有するモノエチレン性不飽和単量体を必須構成分とする水溶性重合体。

重合脂肪酸とポリアミン(ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミンなどのポリアルキレンポリアミンなど)とのポリアミドでアミン価が通常100~700、好ましくは200~500 のものなど。

(5) ポリアミド、窒素含有有機化合物、多価アルコール等の A O 付加物で水容性のもの。

AOとしては炭素数2~4のアルキレンオキサイド(EO、PO、プチレンオキサイドなど)があげられる。

具体的にはポリアミドのポリオキシアルキレン 誘導体(特公昭 51-44275号公報)、イオウ含有 ポリアミドのポリオキシアルキレン誘導体(特公 昭 57-43199号公報)、ポリアルキレンポリアミ ンのポリオキシアルキレン誘導体(特公昭 58 -21958号公報)、アンモニア、モノアミン、酸 アミドなどのポリオキシアルキレン誘導体(特闘 昭 54-116565 号公報)、少なくとも5 価の アルコールのポリオキシアルキレン誘導体(特別 昭 54-105653 号公報)があげられる。 特価昭 60-61415 号明智に記載のものが使用できる。たとえば以下の記載の単独または共重合体があげられる。

重合体 No. 1: アクリル酸 / 2 - ヒドロキシエチルメタアクリレート / メチルアクリレート (73:26:1) 共重合体のナトリウム塩。

重合体Na 2 : ジメチルアミノエチルメタアクリレート重合体のプロピオン酸塩。

重合体Na 3: マレイン酸/アクリル酸/メチルメ タアクリレート (30:60:10) 共重 合体のナトリウム塩。

重合体 Na. 4: アクリル酸/2-ヒドロキシエチル メタアクリレート (70:30) 共重合 体のトリエタノールアミン塩。

重合体No.5:マレイン酸/アクリル酸/2-ヒドロキシエチルメタアクリレート(30:60:10) 共重合体のトリエタノールアミン塩。

(4) 重合脂肪酸ポリアミド

分散剤(V)のうち好ましいものはポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコールおよび(3)に記載した水溶性重合体である。

本発明におけるダイヤモンド砥粒は天然から得られたものでも、また人工的に合成されたものでもよい。その平均粒径は通常 20 μ 以下好ましくは 10 μ 以下である。平均粒径が 20 μ より大きいものは、研磨所要時間は短縮されるが研磨加工面の表面担さが大きくなり、さらに粒径を使用した加工板で再度研磨加工する必要がある。また水中に安定に分散させることが困難である。

 のアルカリ金属塩、アミン塩など、PH調整剤たとえば上記アミンやアルカリ金属の水酸化物など、および消泡剤たとえばシリコーン化合物やポリエーテル化合物などをあげることができる。

本発明の加工液の処方を示せば下記の通りである。

(%は加工液の重量に対する%である。

分散剤(A) 通常 0.1~5 0% (好ましくは 1~3 0%) 浸透剤(B) 通常 0.1~2 0% (好ましくは 0.1~5%) ダイヤモンド砥粒

通常 0.1~10%(好ましくは 0.2~5%)

上記において分散剤の含有量が 0.1 より少ないとダイヤモンド低粒を水中に安定に分散させる効果が小さくなり、また 50%をこえると加工液の粘度が高くなり取扱いにくい。

浸透剤の含有量が 0.1 より少ないと加工液のぬれ性、展着性が不十分でダイヤモンド砥粒を研磨 加工材へ十分供給できない。また、 20% を越えて

レス、アルミニウム、銅、ニッケルなど)、プラスチック(ナイロン、ポリアセタール、ポリカーポネート、変性ポリフェニレンオキサイドなど)、ガラスおよびこれらの複合材料(セラミックーフェライトなど)があげられる。

このような被研磨材料は一般に従来より用いられているラッピングマシン(日本エンギス社製、スピードファム社製、ワシノ機械製、不二越機械工業製)などで研磨される。

本発明の加工液の適用法は、従来の加工液の適用法と同様でよく、たとえば研磨加工においてラップブレートに加工液を適下またはスプレーすればよい。

(実施例)

以下実施例により本発明をさらに説明するが本 発明はこれに限定されるものではない。実施例中 の多は重量基準である。

実施例1~8

本発明の加工液(実施例1~8)を表-1の通 り作成した。参考品(参考例1~4)も表-1に も添加しただけの効果は認められない。

ダイヤモンド砥粒の含有量が 0.1 % より少ないと研密所要時間が長くなり、また 1 0 % をこえると 被研密材料表面の端 ダレ量が大きくなり、 添加しただけの効果はみられず経済的に不利である。

本発明の加工液の製造は、あらかじめ分散剤および浸透剤溶解させた水にダイヤモンド低粒を混合して攪拌により分散させる方法でも、また、分散剤、浸透剤、水およびダイヤモンド低粒を同時に混合して攪拌により分散させる方法でもよい。

添加剤成分は分散剤によりダイヤモンド低粒を水に分散させた後でも、またこれら4成分と同時に加えて溶解させてもよい。

機样方法としてはマグネチックスターラー、羽 根式機拌機、ホモミキサーなどを用いる方法があ げられるがいずれの方法によつて攪拌してもよい。 また必要に応じて提拌時加熱をしてもよい。

本発明の加工液が用いられる設研磨材料としては、セラミツクス(硅石系、アルミナ系、炭化ケイ素系、 窒化ケイ素系など)、 金属(矧、ステン

示す。

卷 - 1

		水	#1 EE	5	散	剤 *2	復	浸透剤*3			
		小	粒	I	D	Ш	1	ū	101	方 清 剂	
	1	9 5.5%	1	2.5	0	0	1	0	0	0	
	2	9 5.0 %	ı	2, 5	0	0	0.5	0	0	1	
実	3	9 4.5%	1	2. 5	0	0	1	0	0	1	
施	4	9 0.5%	1	2. 5	0	0	5	0	0	1	
""	5	9 4.5%	1	2.5	0	0	0	1	0	1	
例	6	9 4.5 %	1	2. 5	U	0	0	O	1	1	
	7	9 4.5 %	1	0	2.5	0	1	O	0	1	
	8	9 1.0 %	1	0	0	6. 0	1	0	0	1	
参	1	9 6.5 %	1	2, 5	0	0	0	0	0	0	
考	2	9 5.5%	1	2. 5	0	0	0	0	0	1	
例	8	9 5.5%	ı	0	2.5	0	0	0	0	1	
	4	9 2.0%	1	0	0	6.0	0	0	0	1	

* 1 砥粒 :ダイヤモンド砥粒(平均粒径 0.5 μ)

*2 分散剤Ⅰ:ポリビニルピロリドン(和光純薬

工業製化粧品用 K-30)

① : ポリエチレングリコール(三洋化 成工業製 PEG 4000(平均分子銀 4000)) Ⅱ: 重合体 № 1 (約40% 水溶液)

(注・重合体 Na 1 は前記分散剤の

の項で説明した。

* 3 忍透削I:ジオクチルスルホコハク酸エステ

ルナトリウム塩

Ⅱ:ドデシルベンゼンスルホン酸ナト

リウム塩

II: ノニルフエノールEO如

本発明の加工液(実施例1~8)および比較品 として市販の加工液(比較例1~3)を用いて行 なつた経時安定性結果を表-2に示す。

なお比較例1および2は、いずれも平均粒径 0.5 μ のダイヤモンド砥粒を1%含有する水を分散 媒とした加工液である。比較例3は特開昭55-139479 号公報の発明の詳細な説明に記載されて いる加工液の組成(粒径 0.08~0.1 μ の酸化マグネ シウムをグリセリンと水の混合液に加えたもの) に準じて、酸化マグネシウムの代りに平均拉径 0.1μのダイヤモンド砥粒を使用し、ダイヤモンド 砥粒1.0%、グリセリン2.5%および水96.5%の割合

3に示す。

表 - 3

項	目	実 施 例								参考例			
74	B	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
接触	角*4(°)	17	17	15	10	17	17	15	15	75	20	20	20
ひろがり	性"红	2.3	2.2	2.5	3.5	2.3	2.3	2.5	2.5	0.9	1.5	1.5	1.5
流れ	性「6口	7.5	7	8	10	7.5	7.5	8	8	0	3.5	4	3.5

- ※4 接触角は銅板に対する加工液の接触角を示す。
- *5 ひろがり性は水平な銅板上に加工液を 0.1 me 滴下したときの加工液の銅板上での直径を示
- *6 流れ性は銅板を水平より 30°傾け、その上方 から加工液を 0.1 ml 滴下したとき、加工液が **銅板上を流れる距離を示す。**

(注・この実験で用いた銅板は JIS H3100 に 規定された材質 C1100P のもの。)

表 - 3の結果から本発明の加工液は研摩材料へ のねれ性および展着性が極めて良好であることが わかる。

で混合したものである。

表 - 2

静置時間			爽	Ħ	II	例			比	較	例
IIP EXAMIN	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
0 時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ö	0	0	0	0	0	0	0	Δ	×	×
2	0	၁	0	0	0	0	0	0	×	×	×
5	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
10	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×

経時安定性試験は各加工液を室温で静置し分散 状態を肉银で観察した。なお、表 - 2 中の記号は 次の通りである。

〇:均一に分散

ム:やや分離

× : 分離

表 - 2 の結果から本発明の加工液は分散安定性 が極めて良好であるととがわかる。

本発明の加工液および参考品(参考例1~4) の研摩材料へのぬれ性および展養性について表一

(発明の効果)

本発明の加工液は下記の効果を奏する。

(1) 加工液の分散安定性がよく、経時的に低粒が 沈降しにくい。この結果一定量のダイヤモンド低 粒を被研解材に安定に供給できるため作業性が向 上する。さらに砥粒が経時的に沈降しにくいため、 匹粒の含有量が少ない加工液が被研薬材料に供給 され研摩所要時間が長くなつたりすることがなく、 加工液を供給する前にあらかじめ攪拌混合する必 要もなく、作業性を著しく改善させる。

(2) 研摩材料へのぬれ性および展着性に極めて受 れるため使用する加工液が少なくてすみ、経済的 に優位である。

③分散剤の含有量および分子量を変えることに より低粘度の加工液から高粘度の加工液まで目的 にあわせたものを使用できる。

(4) 高品質、高精度の研磨加工面を得ることがで きる。

⑤水を分散媒にしているため火災の危険性がな い。

(6) 被研磨材料から加工液の除去が容易である。

(7) 本発明の加工液はセラミック、 金属、 ガラス、 プラスチックなどの材料の表面研密に有用である。 (8) 低粒そのもののもつている特性を損うことが ない。

上記効果を奏することから、本発明の加工液は電子部品分野の著しい進歩に伴い望まれてきている電子部品材料の高品質、高精度の表面研磨加工に有用である。

特許出願人 三洋化成工業株式会



(1)明細書第1頁の発明の名称の欄の「研摩加 工液」を「研磨加工液」に訂正する。

(2) 同書第1~第2頁の特許請求の範囲を

「1. 水溶性高分子分散剤(A) 、浸透性界面活性剤(B)、水およびダイヤモンド砥粒を含有することを特徴とする研磨加工液。

- 2. (B) の含有量が加工液の重量に基いて 0.1~20%である特許請求の範囲第1項記載の 加工液。
- 3. (B) がスルホコハク酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、(アルキル)ナフタリンスルホン酸塩がは、(アルキル)ナフタリンスルホン酸塩のホルマリン稲合物、アルカンスルホン酸塩、アルキル硫酸エステル硫酸化物、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルからなる群よりでは第2項記載の加工液。
 - 4. (A) の含有量が加工液の重量に基いて

手統細正部

昭和60年8月29日

特許庁長官 宇 賀 道 郎 敬

1. 事件の表示



ダクー/を415 Y 昭和60年8月21日提出の特許願

2. 発明の名称

研磨加工液

3. 福正をする者

事件との関係 特許出願人 住所 京都市東山区一橋野本町11番地の1 名称 (228) 三洋化成工業株式会社 で 代表者 前田 常一高

- 4. 補正命令の日付 自 発
- 5. 補正により増加する発明の数 O
- 6. 補正の対象 明細멸の発明の名称、特許請求の範囲および発明の詳細な説明 の各脳
- 7. 補正の内容 別紙の通り。



方式 (奈)

0.1~50%である特許請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項に記載の載の加工液。

5. (A) が(I)ポリビニルピロリドン、(2)ポリエチレングリコールおよび/または(3)カルボン酸(塩)基、アミノ基、水酸基、エーテル基、アミド基および第4級アンモニウム塩基からなる群より選ばれる基を含有するモノエチレン性不飽和単異体を必須構成成分とする水溶性重合体である特許請求の範囲第1項~第4項のいずれか一項に記載の後の加工液。

と訂正する。

(3)下記の箇所の「研摩」を「研磨」に訂正する。

頁	2	2	2	3 ;	3	3	16	17	18	18
行	12	14	20	3~4	4	9	20	18	5	7

頁	18	18
行	8	11